

課題番号 : F-16-HK-0032
利用形態 : 機器利用
利用課題名(日本語) : 残膜処理
Program Title (English) : Remaining film treatment
利用者名(日本語) : 長谷川規史
Username (English) : N.Hasegawa
所属名(日本語) : イムラ・ジャパン株式会社
Affiliation (English) : IMRA JAPAN Co. Ltd.

1. 概要(Summary)

透明導電性ガラス基板上にナノインプリントで作成した構造物を用いて、幾何学形状物を作成。
余剰樹脂を酸素アッシングで取り除く。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

反応性イオンエッチング装置 RIE-10NRV

【実験方法】

試料を RIE-10NRV にセットし、O₂:10 cc/min、
100 W でアッシング処理を行った。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

ナノインプリントに用いた樹脂は 80 nm/min 以上の速度でアッシングできた。

4. その他・特記事項(Others)

なし

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。